

サンアプロの非イオン性光酸発生剤

Nonionic Type Photo Acid Generators of SAN-APRO

●自社の蓄積されたデータを基に新しい組成を設計

Design an unprecedented new products based on our accumulated data

NPシリーズ (開発品)



特長

- ・ トリフレート (TfOH) 発生型
- ・ 高熱安定性
- ・ 高溶剤溶解性

製品名

機能

NP-TM2

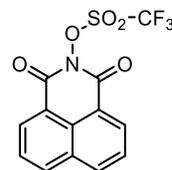
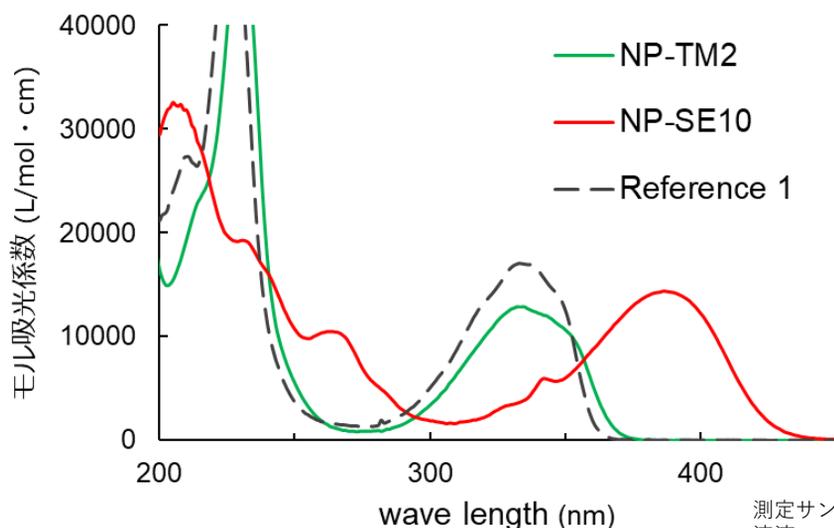
・ i線対応

・ 高透過率 (厚膜へ適用可)

NP-SE10

・ i線高感度

・ 長波長 (g線, h線) 対応



Reference 1
(ナフタリミド スルホネート)

測定サンプル：0.025mMアセトニトリル
溶液



サンアプロの非イオン性光酸発生剤

Nonionic Type Photo Acid Generators of SAN-APRO

特長 Features

		<i>NP-TM2</i>	<i>NP-SE10</i>	Reference 1
構造分類		イミドスルホネート型		
発生酸		トリフルオロメタンスルホン酸 (TfOH)		
<物性>				
モル吸光係数	@365 nm (i線)	2300	10000	500
	@405 nm (h線)	0	10000	0
	@436 nm (g線)	0	400	0
溶解度 (wt%)	PGMEA	>20%	>20%	1%
	γ -ブチロラクトン	>20%	>20%	2%
熱分解温度 (耐熱安定性)		>200°C		
<機能 (相対評価)>				
相対光分解率		1.8	3.2	1
相対レジスト感度 E_{th}		0.8	0.6	1
アミン存在下での相対分解率 (耐アミン性)	ピリジン	1.0	1.0	1
	トリエチルアミン	1.8	2.0	1

<評価条件>

- ・ モル吸光係数：アセトニトリル溶液のUV-vis吸収より算出
- ・ 光分解率：高圧水銀灯(340nm以下をカット)照射前後の成分変化量をHPLCより算出
- ・ レジスト感度：6 μ m厚のポジ型フォトレジストによる評価(E_{th} ：残膜が0となる露光量)
- ・ 熱分解温度：TG-DTA分析での5%重量減少温度
- ・ アミンでの分解率：アミン共存下、遮光・室温にて24時間保管後の成分変化量をNMRより算出

- ・ NP-TM2, NP-SE10ともに高感度であり、溶剤溶解性が高い
- ・ NP-TM2は透過率が高く、厚膜への適用が可能
- ・ NP-SE10は長波長 (g線、h線) に対応

